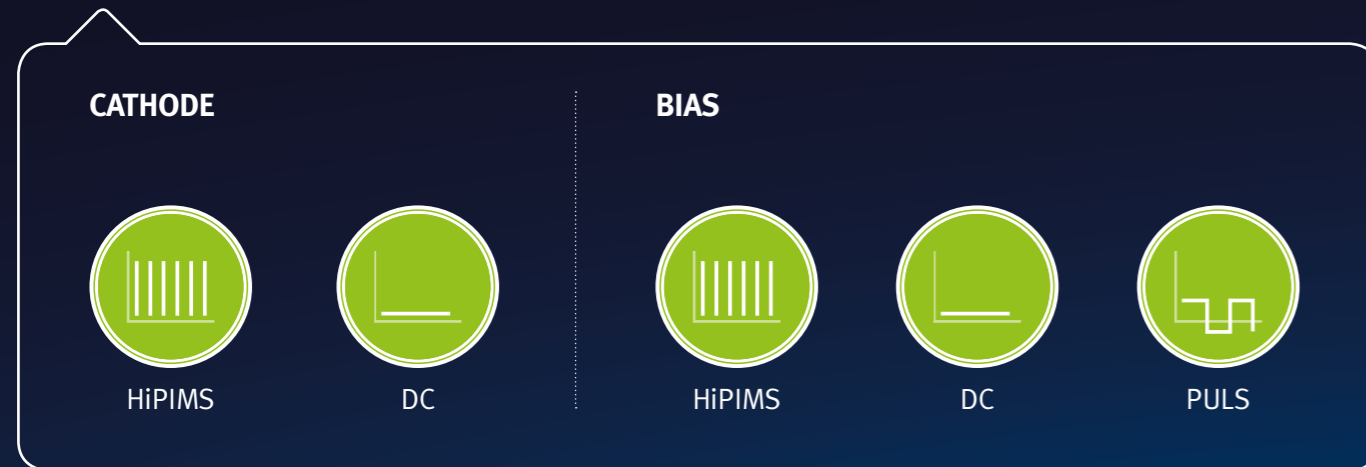


CC800[®] HiPIMS

HiPIMS HIGH POWER IMPULSE MAGNETRON SPUTTERING



Volume utile Ø x h	[mm]	Ø400 x 400
Table, Satellite x Nombre de Satellites	[mm], Nombre	Ø400 x Ø130 x 6
Cathodes	Nombre, [mm]	6 x 500 (dont 4 programmables HiPIMS/DC + 2 autres DC. Toutes les cathodes possèdent un système d'écran)
Volume de la chambre Ø x h	[mm]	Ø400 x 800
Capacité outils cylindriques Ø6 mm x 60 mm	Nombre	1.800
Capacité plaquettes de coupe 12,7 mm x 3,5 mm	Nombre	4.920
Chargement	[kg]	250
Taux de déposition	µm/h	2 µm/h HiPIMS
Temps de cycle pour 3 µm FerroCon^{®*}	[h]	4,5
Processus		HiPIMS et Sputtering avec une Technologie Booster. Tous les revêtements CemeCon sont réalisables.
Activation de la surface (Plasma)		Booster-, MF- und HiPIMS
Revêtement électriquement conducteur		oui
Revêtement non électriquement conducteur		oui
Support non électriquement conducteur		oui
Raccordement électrique	[kW]	80
Consommation électrique par charge pour 3 µm FerroCon^{®*}	[kWh]	120
Dimensions totales (b x l x h)	[mm ³]	1.450 x 3.350 x 2.200

* Revêtement HiPIMS sur fraises de 10 mm, chargement complet, Triple Rotation